



【コンポーネントの特徴】

酸化物や絶縁物のスパッタを可能とするのが RF イオンスパッタです。

真空装置の ICF サービスポートに組み込み可能なコンポーネントタイプの RF イオンスパッタ源です。

1インチタイプ、2インチタイプをラインナップしております。

ご希望のスパッタリング材料については要相談となりますので、ご希望を添えてお問い合わせください。

【仕様】

スパッタ源型式	VMC-25	VMC-50
非磁性ターゲット	Φ25.4 t=2mm (t=3mm 対応可)	Φ50.8 t=3mm
磁性ターゲット	要相談	Φ50.8 t=1mm
最大入力	RF100W	RF200W
取付フランジ	ICF70	ICF152
フランジ～ターゲット間寸法	60～200mm(※1)	135～200mm(※1)
取付姿勢	自由	
ベーキング温度	100℃	
冷却水量	1.5L/min 以上	2L/min 以上
電源型式	RG-100M	RG-300M
最大出力	RF100W	RF300W
マッチング方式	手動(マッチングボックス内蔵型)	自動/手動(マッチングユニットは別置きになります)

※取付寸法等カスタマイズ可能です。詳細はお問い合わせください。

(株)真空デバイス/城里工場

〒311-4305 茨城県東茨城郡城里町上青山298-1

☎ 029-240-6005(FAX6008)

HP <http://www.shinkuu.co.jp>